

第20回放射光学会年会 タイムテーブル

		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
12 日 (金)			10:40~12:25			13:30~ 15:00		15:10~ 16:10		16:20~ 17:50		18:00 ~ 19:00	19:00 ~ 20:00
	A会場 (200名)		オーラル1A (回折・散乱)	昼 食	企画 1 新マンモグ ラフィ開発		総会		奨励賞受賞 講演 (3講演)		SPri ng-8 懇談 会	KEK- PF 懇 談会	
	B会場 (200名)		オーラル1B (VSX (固体))		企画 2 界面の世界 に光								
	C会場 (150名)		オーラル1C (VSX (原子分 子))		企画 3 気体原子・ 分子内殻励 起								
	D会場 (150名)		オーラル1D (BL・装置/表面)		企画 4 産業応用								
	G会場			評議会	休憩室								
	特別展示				施設報告と企業展示準備								

		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		9:00~10:30	10:40~12:40			13:30~15:30		15:50~17:30		18:15~20:45			
13 日 (土)	A会場 (200名)	企画5 コヒーレン ト光発生技 術	特別企画 (10:40~12:10)		昼 食	市民公開講座 (会場：ヒマワ リ)		特別講演 (会場：ヒマワ リ)		懇親会 広島厚生年金会館			
	B会場 (200名)	企画6 内殻磁気光 学	UVSOR 懇 談会	VSX懇談会									
	C会場 (150名)	企画7 タンパク質 構造解析				ポスター セッションI (ポスター会場)							
	D会場 (150名)	企画8 高分子・ソ フトマテリ アル											
	G会場	休憩室											
	特別展示	施設報告と企業展示											

		9	10	11	12	13	14	15	16	
14 日 (日)		9:00~10:30		10:40~12:25		13:30~15:30				
	C会場 (150名)	オーラル2C (加速器・光源)		オーラル3C (回折・散乱)	昼 食	ポスター セッションII (ポスター会場)				
	D会場 (150名)	オーラル2D (イメージング)		オーラル3D (イメージング)						
	E会場 (100名)	オーラル2E (X分光・XAFS)		オーラル3E (VSX(表面))						
	F会場 (100名)	オーラル2F (赤外/生物)		オーラル3F (VSX固体)						
	G会場	休憩室					15:00-17:00 「顕微ナノ材料科学」研究会			
	特別展示	施設報告と企業展示								